

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年3月6日(06.03.2025)



(10) 国際公開番号

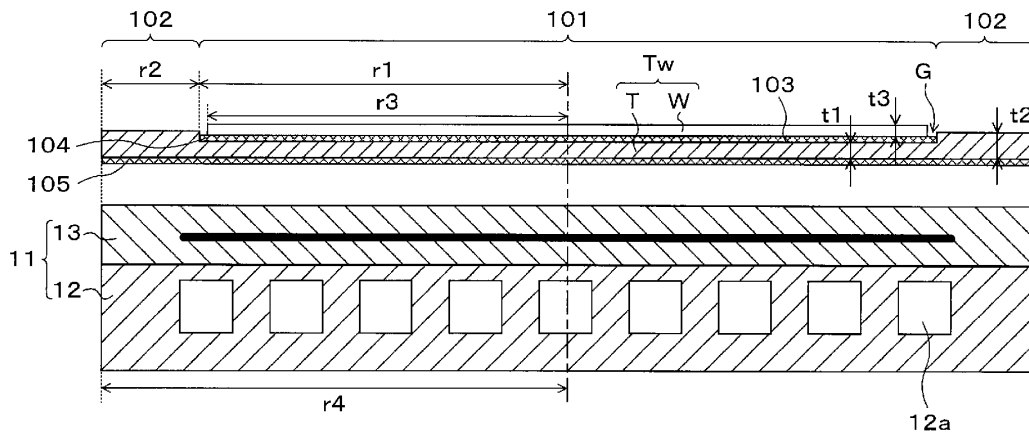
WO 2025/047483 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/673 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
H01L 21/31 (2006.01) H01L 21/3065 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/029278
- (22) 国際出願日: 2024年8月19日(19.08.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-142543 2023年9月1日(01.09.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 松本 直樹 (MATSUMOTO, Naoki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒル

ズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 網倉 紀彦(AMIKURA, Norihiko); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 照内 怜(TERUUCHI, Satoru); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 喜多川 大(KITAGAWA, Dai); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 伊藤 功英(ITO, Koei); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 永関 一也(NAGASEKI, Kazuya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 佐藤 直紀(SATO, Naoki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エ

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS AND SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称: 基板処理装置及び基板処理システム



(57) Abstract: This substrate processing apparatus for processing a substrate comprises: a processing chamber; and a support member arranged in the processing chamber and having a tray support surface for supporting a tray on an upper surface. The tray is formed with a recess for accommodating the substrate on the upper surface thereof. The support member includes a lift pin for lifting the tray at an upper part of the support member. A through hole through which the lift pin is inserted is formed in the support member. The through hole is formed at a position that does not overlap with the tray in a plan view when the tray is arranged on the support member.

[続葉有]



WO 2025/047483 A1

クトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). ▲瀬▼
□ 泰生(SEGUCHI, Taisei); 〒9813629 宮城県
黒川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).

- (74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町 1 - 2 0 角張ビル 曙国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 基板を処理する基板処理装置であって、処理チャンバと、前記処理チャンバ内に配置され、上面にトレイを支持するトレイ支持面を有する支持部材と、を備え、前記トレイは、その上面に前記基板を収容する凹部が形成され、前記支持部材は、前記支持部材の上部で前記トレイを昇降させるリフトピンを含み、前記支持部材には、前記リフトピンが挿通される貫通孔が形成され、前記貫通孔は、前記支持部材に前記トレイが配置された際に、平面視で前記トレイとは重ならない位置に形成される。